This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

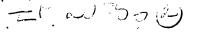
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER **PUBLICATION DATE**

05173102 13-07-93

APPLICATION DATE

26-03-91

APPLICATION NUMBER

03087736

APPLICANT: AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL:

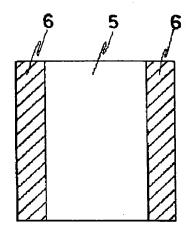
INVENTOR: TOSHIMA HIROAKI;

INT.CL.

: G02F 1/09 C30B 29/22 G02B 27/28

TITLE

FARADAY ROTOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To enable the formation of thicker films and to obtain the Faraday rotor having low light absorption loss by depositing specific crystal films by an ion beam sputtering method on both surfaces of a specific substrate.

CONSTITUTION: Cracks and defects are tend to be generated by strains, etc., by mismatching and the thickness does not increase if the lattice constant difference Δa of the substrate and BilG films increases. Then, the generation of strains and defect is controlled by using a single crystal plate 5 of nonmagnetic garnet having the lattice constant difference Δa within ±0.03°, i.e., 12, 60 to 12, 66° lattice constants. Further, the front and rear surfaces of the substrate 5 are deposited respectively with Bi₃Fe₅O₁₂ films 6 by the ion sputtering method at ≥2.5µm which is the thickness of half the thickness to obtain 45° Faraday rotating angle so as to have the structure to decrease the light absorption loss by increasing the thickness of the BilG films as far as possible. The Bi₃Fe₅O₁₂. films 6 are formed of a single crystal or polycrystal.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-173102

(43)公開日 平成5年(1993)7月13日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G 0 2 F	1/09	501			
C 3 0 B	29/22	D	7821 — 4 G		
G 0 2 B	27/28	A	9120-2K		

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号	特顯平3-87736	(71)出願人 000240477
		並木精密宝石株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)3月26日	東京都足立区新田3丁目8番22号
		(71)出願人 390014535
		新技術事業団
		東京都千代田区永田町2丁目5番2号
		(71)出願人 000001144
		工業技術院長
		東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
		(72)発明者 髙橋 勉
		東京都足立区新田3丁目8番22号 並木精
		密宝石株式会社内
		(74)指定代理人 工業技術院電子技術総合研究所長
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ファラデー回転子

(57)【要約】

【目的】 ファラデー効果が大きなBi, Fe, O₁, 膜を通常のスパッタ法により成長させる際に、基板と膜の格子定数差により、ミスマッチによる歪などのために二次核生成などの表面欠陥が生じる欠点があるため、厚膜化でき低光吸収損失なる45 ファラデー回転子を得る。

【構成】 格子定数が B_1 , Fe, O_1 , I膜の ± 0.03 Å以内である、 $12.60\sim12.66$ Åの範囲にある非磁性ガーネット単結晶基板を用い、イオンビームスパッタ法により B_1 , Fe, O_1 , を、このガーネット基板表裏にそれぞれ 2.5μ m以上となるように推積した $600\sim850$ nm短波長用の光アイソレータ用ファラデー回転子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 格子定数が12.60~12.66Åの範囲にある 非磁性ガーネット単結晶基板に、イオンピームスパッタ 法によりBi, Fe, O,, 単結晶または多結晶膜を、少なくと も片面の厚さが2.5µm以上となるように基板両面に推積 することを特徴としたファラデー回転子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光通信、光計測、光記 録などに用いられる光アイソレータで、特に600~850nm 10 の波長帯で使用される光アイソレータ用ファラデー回転 子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】光通信,光計測に使用される半導体レー ザは、戻り光があるとモードホッピングノイズなどが生 じ、安定なレーザ発振ができなくなる。また最近では、 光ディスク、光磁気ディスクなどの光記録においても光 源として半導体レーザが使用され、戻り光は不具合を生 じるために光アイソレータの必要性が高まっている。 【0003】一般に光アイソレータは図2に示すよう に、偏光子1、検光子2と光の偏波面を45 回転させる ファラデー回転子3, そのファラデー回転子3を磁気飽 和させるための永久磁石4からなる。そして半導体レー ザから発振される順方向の光は通過させ、逆に戻ってく る逆方向の光はファラデー回転子の非相反作用により、 順方向での偏波面からさらに45回転させることによ り、偏光子1とクロスニコルの関係となるため、 戻り 光は遮断される。

【0004】これまで実用化されている光アイソレータ は、波長が1310nm、1550nmといった近赤外域でのものが 多く、これは光通信用のファイバーなどがその波長にお いて光損失が低く、光通信用として適しているためであ ることと、ファラデー回転子として使用されるバルクの Y I G(Y, Fe, O,,)結晶やBi置換Y I G (BiY I G)、 さらに液相エピタキシャル法(LPE法)により成長さ せたBi置換ガーネット膜などの光吸収損失もその波長帯 で低いことに起因している。

【0005】一方光記録用などの光アイソレータは、記 録密度の向上と半導体生産性の容易性から780~850nm帯 の波長が用いられている。また最近では半導体レーザの 40 短波長化が進み、波長が670m付近で発振する可視光半 導体レーザが開発され、第2高調波発振(SHG)素子 も開発されたため、それに伴いより短波長での光アイソ レータの使用が提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら前述した バルクのYIG、BiYIGやLPE法で成長させたBi置 換ガーネット膜においては、可視光領域では光吸収損失 が大きく(光の透過率が悪い)、光アイソレータ用のフ ァラデー回転子としては使用が難しい。これは使用する 50 °C, イオン電流密度1.5mA/cm であった。下記の表にλ=

Ptルツボから混入する白金 (Pt) や、フラックスとして 使用される鉛(Pb)等の不純物による影響で、Fe¹⁺など による吸収が避けられなくなるためと考えられている。 また比較的不純物が混入しないフローティングゾーン法 (FZ法)で作製したYIGなどの使用も可能ではある が、ファラデー回転能すなわち単位長さあたり回転する 角度('/cm) が小さく、45 回転するのに必要な光路長 が長くなる欠点がある。

【0007】そとでとれらの解決策としてファラデー効 果を大きくするため、Bi置換量が多く不純物の混入も少 ない気相成長による非平衡な物質Bi, Fe, O, 2 (Bi I G) ガーネットが特開平1-93426号公報において提案され た。ところがこのBilG膜を通常のスパッタ法により成 長させると、2次核生成などの表面欠陥が生じやすく、 厚くすることが難しいため、45のファラデー回転角を 得ることができない。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明は、BilG膜の格 子定数が12.63Åであることから、基板とBi I G 膜の格 20 子定数差△aが大きくなると、ミスマッチによる歪など により、クラックや欠陥が発生しやすくなり、厚くなら ないことを実験的に見出し、△aを±0.03A以内すなわ ち12.60~12.66Aの格子定数をもつ非磁性ガーネット単 結晶基板を用いることにより歪や欠陥の発生を制御して いる。さらにBilG膜の膜厚は、可能なかぎり薄くし、 光吸収損失を低減させる構造となるように基板の表裏 に、それぞれBilG膜で45 ファラデー回転角を得る約 半分の厚みである2.5µm以上にイオンビームスパッタ法 で堆積させ、BilG膜を単結晶または多結晶とすること 30 を特徴としている。

【0009】Bi I G膜のファラデー回転能は膜形成時の 条件により多少変化するが、最もファラデー効果の大き な波長域であり、かつレーザ発信波長である633nmにお いて、最大-90000 /cmが得られ、実用膜厚に換算する と-9' /μ mとなる。したがって45' フアラデー回転角の 半分である22.5°を得るためには、少なくとも2.5µm以 上の膜厚がそれぞれ必要であり、この範囲に限定され る。本発明によれば、非磁性ガーネット単結晶基板の格 子定数がBi I G膜とほぼ一致するので、ファラデー回転 能の大きなBi I G膜を基板の両面に簡単に堆積させると とが可能で、600~850nmの波長帯でも45 回転するファ ラデー回転子が得られ、結果的にその波長帯で光アイソ レータの製作が可能となる。

[0010]

【実施例1】格子定数が12.63人のサマリウム・スカン ジウム・ガリウム・ガーネット基板 {111} 上に、O2を 反応ガスとしたイオンビームスパッタ法により、Bi, Fe, 〇、、膜を基板の両面に堆積させた。 このときのスパッタ 条件としては、酸素分圧2×10 Torr, 基板温度550

* [0011] 633nmにおいて、Bi, Fe: O., 膜をイオンビームスパッタ 法により堆積させたときの本発明と比較例を示す。

	基板の 格子定数	膜 厚	膜厚	回転角	光吸収
本発明	12. 63Å	片面 2.5 μ + 片面 3.5 μ	良 好	44.8°	4. 5dB
比較例	12. 495Å	片面 2.8 μ + 片面 2.9 μ	衰 確欠 陷		<u>·</u>
	12. 61 Å	片面 5.8μ	クラック 表面欠陥		

【0012】膜厚は上記の表に示したように、片面が2. 5μm, 他の片面が3.5μmで、両面を波長633mmの光が通 20 【0014】 過したときファラデー回転角が44.8 であった。なおこ のときのファラデー回転角は、Bi, Fe, O,, 膜の飽和磁化 が1600ガウスであったので、完全に膜が飽和するように 2キロガウス以上の磁界をかけて測定した。また光吸収 損失は2.5dBであった。

【() () 1 3 】B1, Fe, O., 膜の格子定数12.63Åと基板の 格子定数との差が大きい比較例では、表面欠陥、クラッ クなどの不具合が生じ、単結晶又は多結晶膜とならない ため、当然のことながらファラデー回転角が得られず、※

※ 光吸収損失も膨大な値となって測定不能であった。

【実施例2】格子定数が12.64人のガドリウム・ルテシ ウム・ガリウム・ガーネット基板 {111} 上に、実施例 1と同様にして波長780nmで45 回転するファラデー回転 子を作成した。波長が780nmとするとBilG膜のファラ デー回転能は約-30000 /cmとなるので片面約8 u mずつ を両面に堆積させた。下記の表に入=780nmにおいて、Bi "Fe. 〇、腹をイオンビームスパッタ法により堆積させた ときの本発明と比較例を示す。

[0015]

	基板の 格子定数	膜厚	膜 貸	回転角	光吸収
本発明	12. 64 Å	片面 8μm + 片面 8μm	良 好	44. T	1.7dB
比較例	12.495Å	片面 8μm + 片面 10μm	不良		
	12. 161 Å	片面 8μm + 片面 9μm	不良		
	12. 54 Å	片面 8μm + 片面 8μm	クラック	42~43*	>10dB

【りり】6】得られたBilG膜は多結晶膜となったが、 50 ファラデー回転は上記の表に示したように、B1 I G 膜と 5

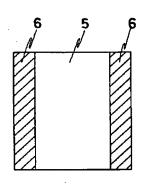
格子定数差が大きい基板を用いると、厚膜化が困難となり、ファラデー回転子が得られなかった。

[0017]

【発明の効果】以上説明したように、本発明を用いることによって堆積制御性のよいイオンビームスパッタ法により、結果的に約45 回転するBi I G 膜が得られるので、600~850nmの波長帯でのファラデー回転子が可能となる。

【図面の簡単な説明】

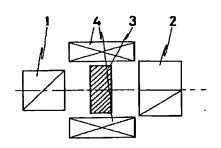
【図1】



*【図1】本発明の 45 ファラデー回転子の構成図。 【図2】光アイソレータの構成図。 【符号の説明】

- 1 偏光子
- 2 検光子
- 3 ファラデー回転子
- 4 永久磁石
- 5 非磁性ガーネット基板
- 6 Bi, Fe, O₁₂膜

【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 戸嶋 博昭

東京都足立区新田3丁目8番22号 並木精 密宝石株式会社内